【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成17年7月14日(2005.7.14)

【公開番号】特開2004-149437(P2004-149437A)
【公開日】平成16年5月27日(2004.5.27)
【年通号数】公開・登録公報2004-020
【出願番号】特願2002-315245(P2002-315245)
【国際特許分類第７版】
　Ｃ０７Ｆ　 9/54
// Ｃ０７Ｂ　61/00
　Ｃ０８Ｇ　85/00
【ＦＩ】
　Ｃ０７Ｆ　 9/54
　Ｃ０７Ｂ　61/00　　３００
　Ｃ０８Ｇ　85/00

【手続補正書】
【提出日】平成16年11月15日(2004.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハロフェノールとトリアリールホスフィンを、金属ハロゲン化物触媒及び重合抑制剤の存在下に反応させてヒドロキシフェニルトリアリールホスホニウムハライドを製造したのち、脱ハロゲン化水素することを特徴とするトリアリールホスホニオフェノラートの製造方法。
【請求項２】
　重合抑制剤が、常圧下における沸点が１５０～３００℃の水酸基又はカルボキシル基を有する化合物である請求項１記載のトリアリールホスホニオフェノラートの製造方法。
【請求項３】
　水酸基を有する化合物が、多価アルコールである請求項２記載のトリアリールホスホニオフェノラートの製造方法。
【請求項４】
　多価アルコールが、エチレングリコールである請求項３記載のトリアリールホスホニオフェノラートの製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　【０００４】
　　【課題を解決するための手段】
　すなわち本発明は、ハロフェノールとトリアリールホスフィンを、金属ハロゲン化物触媒及び重合抑制剤の存在下に反応させてヒドロキシフェニルトリアリールホスホニウムハライドを製造したのち、脱ハロゲン化水素することを特徴とするトリアリールホスホニオフェノラートの製造方法に関する。

【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
ハロフェノールとトリアリールホスフィンの反応は、ハロフェノール自体の重合化を防止するために、重合抑制剤の存在下に行われる。好適な重合抑制剤としては、高沸点、例えば常圧下における沸点が１５０～３００℃の水酸基又はカルボキシル基を含有する有機化合物を挙げることができる。より具体的には、エチレングリコール、１，２－プロピレングリコール、１，３－プロピレングリコール、１，３－ブタンジオール、２，３－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール、グリセリン、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール等の多価アルコール、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル等の多価アルコールのモノエーテル、安息香酸、トルイル酸などの芳香族カルボン酸を例示することができる。これらは２種以上混合して使用することができる。これらの中ではとくに多価アルコールの使用が最も好ましい。上記重合抑制剤の好適な使用量は、ハロフェノール１重量部当り、０．１～１０重量部、とくに０．５～５重量部の範囲である。